

# 資料10 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む）及び土壌の汚染に係る環境基準（令和7（2025）年12月末現在）

ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、次のとおりとする。

## 第1 環境基準

- 1 環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。
- 2 1の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、ダイオキシン類による汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同表の測定方法の項に掲げる方法により行うものとする。
- 3 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
- 4 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
- 5 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
- 6 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。

## 第2 達成期間等

- 1 環境基準が達成されていない地域又は水域にあつては、可及的速やかに達成されるように努めることとする。
- 2 環境基準が現に達成されている地域若しくは水域又は環境基準が達成された地域若しくは水域にあつては、その維持に努めることとする。
- 3 土壌の汚染に係る環境基準が早期に達成されることが見込まれない場合にあつては、必要な措置を講じ、土壌の汚染に起因する環境影響を防止することとする。

## 第3 環境基準の見直し

ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宜見直すこととする。

### 別表

媒体	基準値	測定方法
大気	0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質 (水底の底質を除く)	1 pg-TEQ/L以下	日本産業規格K0312に定める方法
水底の底質	150pg-TEQ/g以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土壌	1,000pg-TEQ/g以下	土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾパーラジオキシンをいう。以下同じ。）及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を2種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。）
備考		
1 基準値は、2, 3, 7, 8 - 四塩化ジベンゾパーラジオキシンの毒性に換算した値とする。		
2 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。		
3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。		
4 土壌にあつては、環境基準が達成されている場合であつて、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあつては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。		

# 資料11 ダイオキシン類に係る規制の状況（令和7（2025）年12月末現在）

<p>根拠法令 大気排出基準</p>	<p>ダイオキシン類対策特別措置法 第8条 (対象) 法に基づく大気基準適用施設（5種類） (規制対象物質及び基準値)</p> <table border="1" data-bbox="513 401 1852 984"> <tr> <td colspan="4">規制対象物質 ダイオキシン類</td> </tr> <tr> <td colspan="4">基準値 [単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特定施設の種類の種類</td> <td>新設施設</td> <td>既存施設</td> </tr> <tr> <td colspan="2">①焼結鋳（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1ト/h以上のもの</td> <td>0.1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">②製鋼用電気炉（銑鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。）であって、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの</td> <td>0.5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">③亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋳炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">④アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限る。）の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉、乾燥炉にあつては原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの、溶解炉にあつては容量が1ト以上のもの</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">⑤廃棄物焼却炉（火床面積が0.5㎡以上、又は焼却能力が50kg/h以上）</td> <td>焼却能力</td> <td>4ト/h以上</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2～4ト/h</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2ト/h未満</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>備考 許容限度は温度が零度であつて、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。</p>			規制対象物質 ダイオキシン類				基準値 [単位：ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]				特定施設の種類の種類		新設施設	既存施設	①焼結鋳（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1ト/h以上のもの		0.1	1	②製鋼用電気炉（銑鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。）であって、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの		0.5	5	③亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋳炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの		1	10	④アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限る。）の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉、乾燥炉にあつては原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの、溶解炉にあつては容量が1ト以上のもの		1	5	⑤廃棄物焼却炉（火床面積が0.5㎡以上、又は焼却能力が50kg/h以上）	焼却能力	4ト/h以上	0.1		2～4ト/h	1		2ト/h未満	5
規制対象物質 ダイオキシン類																																									
基準値 [単位：ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]																																									
特定施設の種類の種類		新設施設	既存施設																																						
①焼結鋳（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1ト/h以上のもの		0.1	1																																						
②製鋼用電気炉（銑鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。）であって、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの		0.5	5																																						
③亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋳炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの		1	10																																						
④アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限る。）の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉、乾燥炉にあつては原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの、溶解炉にあつては容量が1ト以上のもの		1	5																																						
⑤廃棄物焼却炉（火床面積が0.5㎡以上、又は焼却能力が50kg/h以上）	焼却能力	4ト/h以上	0.1																																						
		2～4ト/h	1																																						
		2ト/h未満	5																																						
<p>水質排出基準</p>	<p>第8条 (対象) 法に基づく水質基準適用施設（19種類）を設置する工場又は事業場 (規制対象物質及び基準値(排水口))</p> <table border="1" data-bbox="513 1158 1852 2469"> <tr> <td colspan="2">規制対象物質 ダイオキシン類</td> </tr> <tr> <td colspan="2">基準値 [単位：pg-TEQ/L]</td> </tr> <tr> <td>特定施設</td> <td>新設、既設施設</td> </tr> <tr> <td>①硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設</td> <td rowspan="19">10</td> </tr> <tr> <td>②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑤担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑥塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑦カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る）の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑨4-クロロフル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフチンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑪8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロベンゾ(3,2-b:3',2'-m)トリフェニルジシラン（別名ジシランバイオレット）製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設</td> </tr> <tr> <td>⑫アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td> </tr> <tr> <td>⑬亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る）の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td> </tr> <tr> <td>⑭担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設</td> </tr> <tr> <td>⑮廃棄物焼却炉（大気排出基準に係る特定施設の⑤）から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であつて汚水又は廃液を排出するもの</td> </tr> <tr> <td>⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設</td> </tr> <tr> <td>⑰フロン類の破壊（プラズマを用いて破壊する方法等）の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td> </tr> <tr> <td>⑱下水道終末処理施設（この表の①～⑰及び⑲の施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）</td> </tr> <tr> <td>⑲この表の①～⑰の施設を設置する工場又は事業場から排出される水（①～⑰の施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの）に限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（⑱を除く。）</td> </tr> </table>			規制対象物質 ダイオキシン類		基準値 [単位：pg-TEQ/L]		特定施設	新設、既設施設	①硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10	②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設	③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	⑤担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	⑥塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	⑦カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る）の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設	⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設	⑨4-クロロフル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設	⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフチンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設	⑪8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロベンゾ(3,2-b:3',2'-m)トリフェニルジシラン（別名ジシランバイオレット）製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設	⑫アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	⑬亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る）の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	⑭担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設	⑮廃棄物焼却炉（大気排出基準に係る特定施設の⑤）から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であつて汚水又は廃液を排出するもの	⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設	⑰フロン類の破壊（プラズマを用いて破壊する方法等）の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	⑱下水道終末処理施設（この表の①～⑰及び⑲の施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）	⑲この表の①～⑰の施設を設置する工場又は事業場から排出される水（①～⑰の施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの）に限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（⑱を除く。）												
規制対象物質 ダイオキシン類																																									
基準値 [単位：pg-TEQ/L]																																									
特定施設	新設、既設施設																																								
①硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10																																								
②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設																																									
③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																									
④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																									
⑤担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																									
⑥塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設																																									
⑦カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る）の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設																																									
⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設																																									
⑨4-クロロフル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設																																									
⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフチンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設																																									
⑪8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロベンゾ(3,2-b:3',2'-m)トリフェニルジシラン（別名ジシランバイオレット）製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設																																									
⑫アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																									
⑬亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る）の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																									
⑭担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設																																									
⑮廃棄物焼却炉（大気排出基準に係る特定施設の⑤）から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であつて汚水又は廃液を排出するもの																																									
⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設																																									
⑰フロン類の破壊（プラズマを用いて破壊する方法等）の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																									
⑱下水道終末処理施設（この表の①～⑰及び⑲の施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）																																									
⑲この表の①～⑰の施設を設置する工場又は事業場から排出される水（①～⑰の施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの）に限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（⑱を除く。）																																									
<p>廃棄物焼却炉のばいじん、焼却灰等、燃え殻の処理</p>	<p>第24条 (対象) 法に基づく大気基準適用施設のうち廃棄物焼却炉 (規制対象物質及び基準値) 規制対象物質 ダイオキシン類 基準値 3ng-TEQ/g</p>	<p>廃棄物の最終処分場の維持管理</p>	<p>第25条 (対象) 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場（管理型） (規制対象物質及び基準値) 規制対象物質 ダイオキシン類 放流水の水質基準値 10pg-TEQ/L</p>																																						